

引用信息: Tan Qi-Xian; Liu Shu-Lan; Cheng Dan-Hong; Guo He-Tong. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992, 8(04): 571-574 [覃奇贤;刘淑兰;成旦红;郭鹤桐. 物理化学学报, 1992, 8(04): 571-574]

[本期目录](#) | [在线预览](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

研究简报

铬酸溶液中金属铬电沉积的机理

覃奇贤; 刘淑兰; 成旦红; 郭鹤桐

天津大学应用化学系, 天津 300072

摘要:

关键词: 金属铬 电沉积 铬酸溶液

收稿日期 1991-02-28 修回日期 1992-03-20 网络版发布日期 1992-08-15

通讯作者: 覃奇贤 Email:

本刊中的类似文章

1. [刘淑兰,郭鹤桐,覃奇贤,成旦红.Ce⁴⁺离子对电沉积金属铬的影响\[J\]. 物理化学学报, 1995,11\(10\): 921-924](#)

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(766KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [金属铬](#)

▶ [电沉积](#)

▶ [铬酸溶液](#)

本文作者相关文章

▶ [覃奇贤](#)

▶ [刘淑兰](#)

▶ [成旦红](#)

▶ [郭鹤桐](#)